

N I L トータルソリューション

ファウンドリー～モールド作製から転写まで～

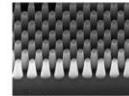
● 微細モールド(金型)

様々な用途に合わせた微細モールドを提供します。
nm～ μ mパターンまで、各種形状に対応。
【対応材料】Si、Ni、石英、樹脂(PDMS)

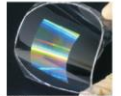
Product	Period	Lattice	Type	Area	Etch depth (silica)	Substrate
P350s	350nm	Square	Holes	20x20mm ²	<300nm / <150nm	Silicon or fused silica, 4" wafer or smaller
P520h	520nm	Hexagonal	Holes	20x20mm ²		
P600h	600nm	Hexagonal	Holes	46x46mm ²	Si: <450nm	
P600h4	600nm	Hexagonal	Holes	4 inch (-95%)	Quartz: <200nm	
P700h	700nm	Hexagonal	Holes	20x20mm ²		
P600hp	600nm	Hexagonal	Pillars	46x46mm ²	<1000nm / <300nm	



Fully patterned 4 inch wafer
Hexagonal array - 600nm pitch



PHABLE high aspect ratio nano-pillars
Hexagonal array - 600nm pitch



PHABLE mold nano-etched on polymer foil (M. Akana, IRIKA Institute)

☆EB描画、干渉露光でのナノパターニングでの実績多数あり!

ナノモールドの購入検討のお客様は是非当社にお問い合わせ下さい。

● 転写サービス

熱/UVインプリントの設備を社内に保有。
初期検討から量産までの開発支援を行います。
射出成型による0.3 μ mパターンの転写も可能。

延べ1200件
以上の実績!



N I L お試しモールド

● ニーズに応じて最適なパターンを選択可能

- お試しモールド① (1~50 μ m)
- お試しモールド② (0.5~2 μ m)
- お試しモールド③ (ナノパターンモールド)
- お試しモールド④ (マイクロレンズアレイ形状)

- お試しモールド⑤ (フォトニック結晶)
- お試しモールド⑥ (反射防止膜)
- お試しモールド⑦ (0.5 μ m広範囲パターン)
- お試しモールド⑧ (高輝度モールド)
- お試しモールド⑨ (石英モールド)

● 離型処理 (Fine MoZiTTM) も対応可能 (オプション)

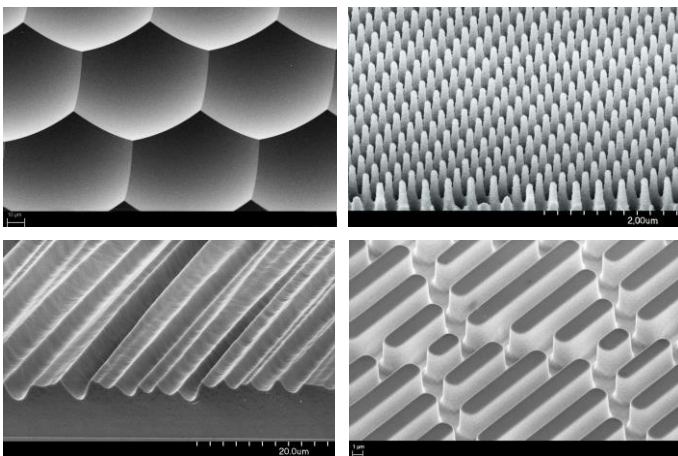
フライングモストTM

NILの初期検討、各種実験に最適です。

temicon社 日本代理店



temicon社製品は当社にお問い合わせください。



temicon社の特徴

- 様々なリソグラフィアプローチによる大面積マイクロナノ構造
- 最小分解能 : 100nm
- ウェハサイズ : ~200mm
- 角基板サイズ : ~1000mm x 1000mm
- 新規取組、設備
- シム金型、ロール金型、入り子金型

お問合せ窓口: 株式会社 協同インターナショナル
電子部 技術 大井秀雄

川崎イノベーションセンター: 〒212-0032 川崎市幸区新川崎7-7 KBIC本館104号室

TEL : 044-200-4151 FAX : 044-200-4131

mail : hideo_oi@kyodo-inc.co.jp



www.kyodo-inc.co.jp

各種ソリューション

モールド洗浄サービス

NILで使用したモールドの洗浄を行います。付着物に合わせた洗浄方法を選定し、転写不具合を解決します。

モールドレプリカ (複製)加工

モールドは非常に高額なものであり、傷ついてしまえば使用することができなくなってしまいます。NIL技術を利用してモールドのレプリカ(複製)を作製するサービスです。

技術コンサルティング

シンガポール物質材料工学研究所 IMRE(Institute of Material and Engineering)との技術提携により、NILの技術コンサルティングを提供します。

ナノインプリント 実演セミナー

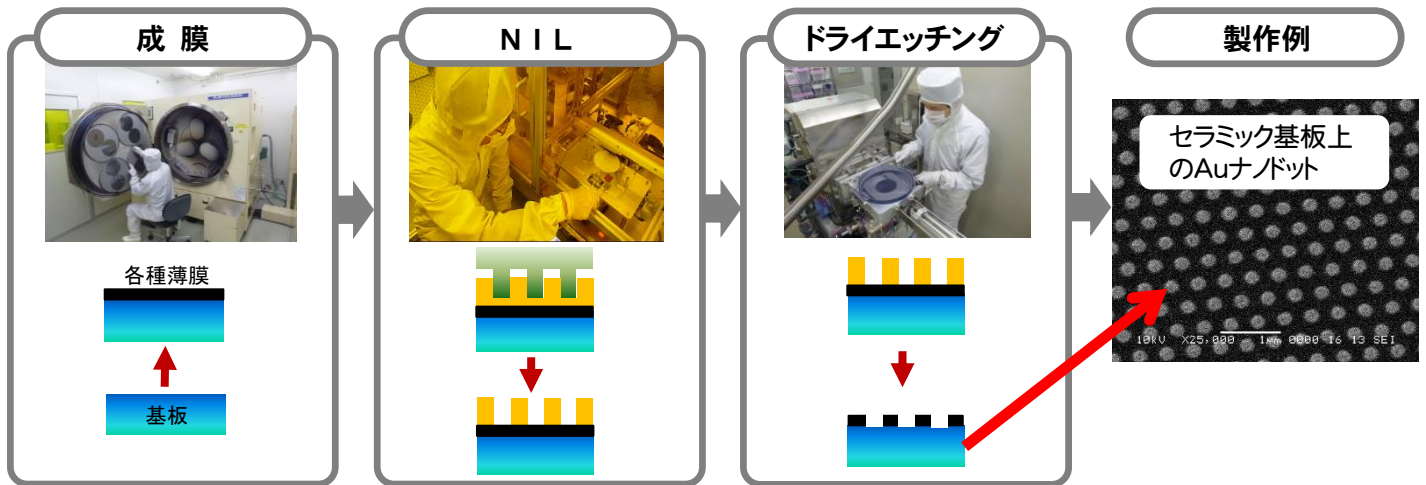
初心者様向けにナノインプリント技術について実際の装置オペレートを通じプロセス技術やその他要素技術の理解を深めていただく目的で実演セミナーを定期開催しています。

成膜→NIL→ドライエッチング受託加工

従来のフォトリソグラフィでは困難なパターンングが、当社微細加工設備で一括で受託可能です。

★このようなお客様に

- ・従来の露光装置に投入できない基板(小片、金属、セラミックス)に微細パターンをつけたい。
- ・少量多品種で受託加工先がない。
- ・ナノサイズ(100nm~)のパターンングをしたい。



PSS用ナノインプリントシステム

TEXシリーズ

TEXシリーズは当社が開発したナノインプリントリソグラフィシステムです。主なアプリケーションとしては青色LED製造に使用されるサファイア基板へのレジストパターン加工となります。マスターモールド・転写装置・UVレジン・レプリカモールドを一括して販売、ご提供いたします。

TEX-01: 研究開発用手動機

TEX-02: セミオート機

TEX-03: 量産用フルオート機

<TEXシリーズ搭載用オリジナルモールドの特許出願中>

※掲載写真はTEX-02

